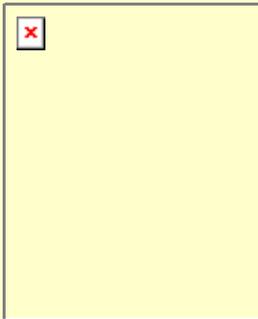


本期封面



2000年10期

栏目:

DOI:

论文题目: Ni-Cr-Al-Y涂层真空热处理过程中元素的行为

作者姓名: 王冰 韩雅芳

工作单位: 中国科学院金属研究所, 沈阳 110015

通信作者: 王冰

通信作者Email:

文章摘要: 采用电弧离子镀技术在铸造镍基合金K17和Ni3Al基合金IC-6沉积Ni-Cr-Al-Y涂层. 结果表明, 在沉积过程中由于电弧离子镀的“溅射”和“反溅射”效应以及基体和涂层发生互扩散的共同作用下, 沉积的Ni-Cr-Al-Y涂层在靠近基体区含有少量基体元素, 如Co, Ti和Mo等, K17合金中的Al元素可抑制Cr由涂层向基体扩散, IC-6合金中由于还含有Mo元素.

关键词: Ni-Cr-Al-Y涂层 真空热处理

分类号: TG174.444 TG156.95

关闭